

(19)



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11) Numéro de publication : **0 578 553 A1**

(12)

DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

(21) Numéro de dépôt : 93401736.9

(51) Int. Cl.⁵ : **C03B 19/10, C03B 37/012,
C03C 1/00, C03B 8/02**

(22) Date de dépôt : 05.07.93

(30) Priorité : 07.07.92 FR 9208369

(43) Date de publication de la demande :
12.01.94 Bulletin 94/02

(84) Etats contractants désignés :
DE FR GB IT NL SE

(71) Demandeur : **ALCATEL N.V.**
Strawinskylaan 341, (World Trade Center)
NL-1077 XX Amsterdam (NL)

(72) Inventeur : **Campion, Jean-Florent**
Rue Jules Lemoine, 3 Résidence Les Tilleuls
F-91290 Arpajon (FR)

(74) Mandataire : **Laroche, Danièle et al**
c/o SOSPI 14-16 rue de la Baume
F-75008 Paris (FR)

(54) Procédé de fabrication d'une poudre de silice et application d'une telle poudre à la réalisation d'une préforme pour fibre optique.

(57) Procédé de fabrication d'une poudre de silice, par une méthode sol-gel, caractérisé par le fait que,

— on réalise une suspension dans l'eau de silice synthétique de silice, de surface spécifique inférieure à 80 m²/g à raison de 50% à 75% en poids de silice,

— on gélifie ladite suspension,

— on sèche sous micro-ondes le gel obtenu et on fractionne le gel-sec en granulés de silice présentant une densité apparente de l'ordre de 0,5 g/cm³ à 0,6 g/cm³ et une porosité inférieure à 20%,

— on effectue un tamisage entre 100 µm et 500 µm.

EP 0 578 553 A1

La présente invention concerne un procédé de fabrication d'une poudre de silice, destinée plus particulièrement mais non exclusivement à la réalisation d'une préforme de fibre optique.

On vise essentiellement le procédé POD c'est-à-dire une technique de dépôt plasma par projection et fusion d'une poudre de silice sur une préforme primaire. Ce procédé est décrit par exemple dans l'article de L. Sergent et al: "Preform Technologies for Optical Fibers" Electrical Communication. Vol 62, N° 3/4 - 1988, page 238.

Jusqu'à présent les poudres de silice que l'on met en oeuvre sont de deux types.

Le premier type est une poudre de quartz naturel ayant une granulométrie satisfaisante, mais pouvant présenter aléatoirement des inclusions susceptibles de fragiliser la préforme ultérieure.

Le second type est une poudre ou suie synthétique présentant une grande pureté mais dont les grains sont si fins (diamètre de grain inférieur à 100nm), que son utilisation rend le procédé POD trop long et trop coûteux. Dans toute la suite, on appellera "sui synthétique de silice" ce second type de poudre. Une telle suie peut être obtenue par exemple par un procédé MCVD; elle peut être aussi pyrogénée, comme la suie vendue sous la dénomination Aerosil Ox-50 et 200 par la Société DEGUSSA.

La demande de brevet Européen EP-A-0271281 décrit par ailleurs une méthode sol-gel pour réaliser un poudre de silice pour préforme de fibre optique. Cette méthode consiste à disperser dans de l'eau de la suie synthétique de surface spécifique égale à 200 m²/g, et à raison de 25% en poids. Le gel obtenu est fractionné par des moyens mécaniques et les granulés obtenus sont séchés. On constate que ces granulés sont extrêmement friables, ce qui rend difficile toute opération ultérieure de tamisage.

La présente invention a pour but d'éviter cet inconvénient et propose un procédé sol-gel aboutissant à des granulés de silice peu friables, présentant une granulométrie et une pureté bien adaptées au procédé POD.

La présente invention a pour objet un procédé de fabrication d'une poudre de silice, par une méthode sol-gel, caractérisé par le fait que,

- on réalise une suspension dans l'eau de suie synthétique de silice, de surface spécifique inférieure à 80 m²/g à raison de 50% à 75% en poids de silice,
- on gélifie ladite suspension,
- on sèche sous micro-ondes le gel obtenu,
- on fractionne le gel-sec en granulés de silice de diamètre compris entre 10 µm et 1 mm, présentant une densité apparente de l'ordre de 0,5 g/cm³ à 0,6 g/cm³ et une porosité inférieure à 20%,
- on effectue un tamisage entre 100 µm et 500 µm.

La silice du gel est transparente aux micro-ondes à la température de séchage. Le gel est séché dans sa masse, sans aucune formation de croûte. Après fractionnement mécanique les granulés obtenus sont peu fragiles et supportent sans se désagréger un tamisage ultérieur.

Selon un mode de mise en oeuvre, on réalise la gélification par chauffage de ladite suspension vers 40°C, on sèche le gel obtenu sous vide et dans un four à micro-ondes et on le fractionne par broyage à l'aide de billes en téflon ou par découpage à l'aide d'une hélice.

Les granulés poreux obtenus par le procédé selon l'invention peuvent être utilisés directement dans la torche à plasma du procédé POD.

De préférence, on projette en même temps que ces granulés, un gaz fluorant, par exemple de type SF₆; le débit de ce gaz peut être réglé de façon que le pourcentage (en poids) de fluor incorporé dans la silice varie entre 0,3% et 1,5%.

Il est possible d'ajouter à ladite suspension, sous forme de poudres d'oxydes ou de sels solubles, différents dopants destinés à modifier l'indice optique et les propriétés mécaniques de la préforme ultérieure; ces dopants (titane, magnésium, calcium, aluminium, baryum, strontium, plomb, phosphore), seuls ou en mélange, sont ajoutés de manière à se trouver en proportion pondérale inférieure à 20%.

Selon une variante de mise en oeuvre perfectionnée l'on effectue dans un four une densification desdits granulés de silice par le traitement thermique suivant:

- Montée de 20°C à 800°C sous oxygène avec une vitesse comprise entre 300°C et 500°C/heure.
- Montée de 800°C jusqu'à une température T comprise entre 1250°C et 1350°C sous atmosphère d'hélium avec un palier isotherme de 1 à 5 heures la température T, la densité des granulés de silice étant en fin de traitement thermique de l'ordre de 2,2 g/cm³.

On peut prévoir en outre, en vue d'éliminer les groupements OH une phase intermédiaire à 800°C dans ledit traitement thermique, avec un traitement sous chlore ou chlorure de thionyle pendant une durée comprise entre 0,5 et 2 heures, suivi d'un traitement vers 1000°C - 1200°C, pendant 1 heure environ, sous oxygène ou mélange hélium/oxygène, destiné à éliminer les groupements Cl.

Pendant la seconde phase du traitement thermique, on peut également mélanger à l'hélium un gaz fluorant choisi parmi SiF₄, CCl₂F₂, HF, SF₆, NF₃, de manière à incorporer dans lesdits granulés 0,1% à 3% de fluor.

Les traitements de densification des granulés qui viennent d'être définis permettent d'accroître la vitesse de l'ur dépôt par le procédé POD, sur une préforme primaire.

D'autres caractéristiques et avantages de la présente invention apparaîtront au cours de la description suivante d'exemples de mise en oeuvre donnés à titre illustratif mais nullement limitatif.

EXEMPLE 1 :

On réalise une suspension de 70 kg de silice dans 530 kg d'eau désionisée. Il s'agit de silice pyrogénée de type Aérosil OX-50 de la Société DEGUSSA présentant une surface spécifique de 50 m²/g.

Le PH de la suspension est égal à 3. On chauffe à 40°C et il se forme un gel que l'on sèche sous vide pendant 8 heures dans une enceinte micro-ondes maintenue à 70°C. Le vide est de l'ordre de 100 mm de mercure au début du séchage.

La puissance micro-onde est de 8 kwatts au début du séchage et elle décroît jusqu'à 1 kwatt en fin de séchage.

On obtient un gâteau séché de manière très homogène sans croûte superficielle.

On le fractionne à l'aide d'une hélice qui tourne à une vitesse comprise entre 40 et 100 tours par minute.

On obtient des granulés de silice de diamètres compris entre 50 µm et 1 mm, la granulométrie étant centrée sur 300 µm. Leur densité est de 0,5 g/cm³.

Après un tamisage entre 100 µm et 500 µm on obtient des granulés représentant 70% de la silice introduite initialement. Les granulés ont une porosité de 10% environ.

On utilise une telle poudre dans la torche à plasma d'un procédé POD avec un débit compris entre 370 et 500 g/heure; la projection est effectuée sur une préforme primaire de diamètre 16 mm devant être portée à 24 mm. La vitesse de croissance de la préforme est de 0,8 mm par heure et par mètre, avec un rendement de matière de 35% à 45%.

EXEMPLE 2 :

On prend la poudre de l'exemple 1 et on la projette sur une préforme primaire de 1 mètre de longueur et de diamètre 18 mm devant être portée à 24 mm.

On projette également dans la torche un gaz fluorant tel que SF₆, avec un débit de compris entre 0,5 et 3 litres par minute. Selon ce débit le pourcentage de fluor incorporé dans la silice déposée est compris entre 0,3% et 1,5%. La vitesse de dépôt est de 0,70 mm par heure et par mètre.

EXEMPLE 3:

On prend la poudre de l'exemple 1 et on lui fait subir le traitement de densification suivant dans un four électrique:

- Montée de 20°C à 800°C sous oxygène avec

une vitesse de chauffage de 300°C/heure.

- Traitement sous chlore à 800°C pendant 1 heure.
- Montée de 800°C à 1350°C sous hélium.
- Palier à 1350°C pendant 3 heures.

Grâce à cette densification, la vitesse de croissance de la préforme précitée dans l'exemple 1 passe à 3 mm par heure et par mètre, avec un rendement de matière de 70% à 85%.

EXEMPLE 4:

On prend la poudre de l'exemple 1 et on lui fait subir le traitement de densification et de fluoration suivant dans un four électrique:

- Montée de 20°C à 800°C sous oxygène avec une vitesse de chauffage de 300°C/heure.
- Traitement sous atmosphère d'hélium et de SiF₄ de 800°C à 1350°C.
- Palier isotherme à 1350°C pendant 2 heures.

Pour 200 grammes de silice le débit de SiF₄ est compris entre 0,5 litre et 2 litres par heure.

Le pourcentage de fluor incorporé est de 1% en poids, si le débit de SiF₄ est de 0,5 litre par heure et le débit d'hélium de 2 litres par heure.

On utilise ce type de poudre pour la recharge par procédé POD d'une préforme de 1 mètre de longueur et de diamètre 18 mm devant être portée à 30 mm. Le débit de silice est de 0,4 Kg par heure.

La vitesse de dépôt est de 2,8 mm par heure et par mètre. La silice déposée contient toujours 1% en poids de fluor, ce qui correspond à un écart d'indice optique $\Delta n = -5 \times 10^{-3}$ par rapport à la silice pure. Le rendement de matière est compris entre 65% et 80%.

Il est très intéressant de constater que le pourcentage de fluor contenu dans la poudre est conservé intégralement dans la silice déposée.

Bien entendu l'invention n'est pas limitée aux modes de réalisation proposés ci-dessus. On pourra, sans sortir du cadre de l'invention, remplacer tout moyen par un moyen équivalent.

Revendications

1/ Procédé de fabrication d'une poudre de silice, par une méthode sol-gel, caractérisé par le fait que,

- on réalise une suspension dans l'eau de silice synthétique de silice, de surface spécifique inférieure à 30 m²/g à raison de 50% à 75% en poids de silice,
- on gélifie ladite suspension,
- on sèche sous micro-ondes le gel obtenu,
- on fractionne le gel-sec en granulés de silice de diamètre compris entre 10 µm et 1 mm, présentant un densité apparent d'ordre de 0,5 g/cm³ à 0,6 g/cm³ et une porosité inférieure à 20%,

- et on effectue un tamisage entre 100 μm et 500 μm .

2/ Procédé de fabrication selon la revendication 1, caractérisé par le fait que l'on réalise la gélification par chauffage de ladite suspension vers 40°C, on sèche le gel obtenu sous vide dans un four micro-ondes et on le fractionne par broyage à l'aide de billes en téflon, ou découpage par une hélice.

5

3/ Procédé de fabrication selon l'une des revendications 1 et 2, caractérisé par le fait que l'on ajoute dans ladite suspension, sous forme de poudre d'oxyde ou de sel soluble au moins un dopant choisi parmi le titane, le magnésium, le calcium, l'aluminium, le baryum, le strontium, le plomb, le phosphore.

10

4/ Procédé de fabrication selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé par le fait que l'on effectue dans un four une densification desdits granulés de silice par le traitement thermique suivant:

15

- Montée de 20°C à 800°C sous oxygène avec une vitesse comprise entre 300°C et 500°C/heure.
- Montée de 800°C jusqu'à une température T comprise entre 1250°C et 1350°C sous atmosphère d'hélium avec un palier isotherme de 1 à 5 heures à la température T, la densité des granulés de silice étant en fin de traitement thermique de l'ordre de 2,2 g/cm³.

20

25

5/ Procédé de fabrication selon la revendication 4, caractérisé par le fait que l'on prévoit une phase intermédiaire dans ledit traitement thermique avec un traitement sous chlore ou chlorure de thionyle à 800°C pendant une durée comprise entre 0,5 et 2 heures, suivi d'un traitement vers 1000°C à 1200°C, pendant 1 heure environ, sous oxygène ou mélange hélium/oxygène, destiné à éliminer les groupements Cl.

30

35

6/ Procédé de fabrication selon la revendication 4, caractérisé par le fait que l'on mélange à l'hélium un gaz fluorant choisi parmi SiF₄, CCl₂F₂, HF, SF₆, NF₃, de manière à incorporer dans lesdits granulés 0,1% à 3% de fluor.

40

7/ Application d'une poudre de silice obtenue par le procédé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé par le fait qu'elle est projetée sur une préforme primaire par une torche à plasma d'un procédé POD.

45

8/ Application d'une poudre de silice obtenue par le procédé selon l'une des revendications 1 et 2, caractérisée par le fait qu'elle est projetée sur une préforme primaire par une torche à plasma d'un procédé POD en même temps qu'un gaz fluorant, le pourcentage (en poids) de fluor à incorporer dans la silice étant compris entre 0,3 % et 1,5 %.

50

55

Office européen
des brevets

RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numéro de la demande

EP 93 40 1736

| DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS | | | |
|---|---|---|---|
| Catégorie | Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes | Revendication concernée | CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int. Cl.5) |
| A | EP-A-0 271 281 (AT&T CO.) * exemple 2; page 5, lignes 4-32; page 8, lignes 4-17; page 13, lignes 7-32; page 15, lignes 22-32 * | 1,7 | C03B19/10 C03B37/012 C03C1/00 C03B8/02 |
| A | US-A-4 042 361 (P.P.BIHUNIAK ET AL.) * colonne 2, ligne 19 - colonne 3, ligne 19; revendications 1,2; exemple 2 * | 1,2 | |
| A | GB-A-2 103 202 (WESTERN ELECTRIC CO. INC.) * exemple 1 * | 1 | |
| A | GB-A-2 229 715 (CABOT CORP.) * revendications 1-6 * | 1 | |
| A | US-A-3 954 431 (J.W.FLEMING ET AL.) * colonne 3, ligne 24 - ligne 44; revendications 1,2,5 * | 1,7 | |
| A | EP-A-0 360 479 (AT&T CO.) * colonne 4, ligne 53 - colonne 5, ligne 10; revendications 1,8,9 * | 1,3,7 | |
| A | JOURNAL OF THE AMERICAN CERAMIC SOCIETY vol. 66, no. 10, Octobre 1983, COLUMBUS US pages 683 - 688 E.M.RABINOVICH ET AL. 'Preparation of High-Silica Glasses from Colloidal Gels: I, Preparation for Sintering and Properties of Sintered Glasses' * page 683 * | 1 | DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int. Cl.5) C03B C03C |
| A | DATABASE WPIL Section Ch, Week 05, 1983 Derwent Publications Ltd., London, GB; Class L01, AN 83-10489K & JP-A-57 205 334 (NT&T) 16 Décembre 1982 * abrégé * | | |
| Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications | | | |
| Lieu de la recherche LA HAYE | | Date d'achèvement de la recherche 22 SEPTEMBRE 1993 | Examineur STROUD J.G. |
| CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES | | | |
| X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire | | T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons * : membre de la même famille, document correspondant | |

EPO FORM 1503 01.87 (P0017)

THIS PAGE BLANK (USPTO)